J08

IV族およびIII-V族半導体の顕微フォトルミネセンス 発光スペクトルから分かること



東京大学

Motivation どんな問題に取り組むのか?

GeはSi-CMOSプロセスと適合性を持つ材料であり、Siフォトニク ス分野における発光デバイスへの応用が期待されています。 顕微フォトルミネセンス(µ-PL)測定で得られるGeの発光スペク トルは異なる励起キャリア密度に対し独特の挙動を示します。 本研究では他のIV族・III-V族半導体(Si, InGaAs, GaAs)との比 較を行い、Geの光物性の解明を目指します。

Originality and Impact 新規性とインパクトは?

異なる対物レンズを用いた場合のスペクトル形状の変化はGe およびInGaAs/InPでは確認されましたが、バルクSiおよび GaAsでは確認されませんでした(図1)。InGaAsの励起光強度 依存性からは、スペクトル形状の変化は強励起のみで起きる ことが分かりました(図3)。スペクトルの変化を紐解くことで非 発光再結合や自由キャリア吸収の機構が明らかになります。



東京大学大学院 工学系研究科 石川研究室